超厚类金刚石涂层的可控制备及其性能

王军军^{1,2}, 蒲吉斌¹, 张广安¹, 王立平^{1*}

1 中国科学院兰州化学物理研究所 固体润滑国家重点实验室,甘肃,兰州,730000;
2 中国科学院研究生院,北京 100039
*通讯作者: lpwang@licp.cas.cn (王立平)

摘要: 类金刚石(Diamond-like carbon, DLC)涂层具有许多与金刚石涂层相似的优异性能,如高硬度,耐磨损,低摩擦系数,并具有良好化学稳定性、电绝缘性、光透性,耐腐蚀性以及生物相容性,其作为新型功能薄膜材料,在机械、电子、光学航天航空和生物相容性诸多领域具有广泛的应用。DLC 作为功能防护涂层,典型膜层厚度在 1~5μm,在汽车制造业和航空航天领域等特殊应用领域膜层厚度需求可达 10~50 μm 左右。同时试验表明,膜层越厚,涂层耐磨性能和抗腐蚀性能更优异,所以制备超厚 DLC 涂层尤为迫切。然而,DLC 由于其高的内应力,厚度限制在 10μm 以内,从而限制了 DLC 涂层的应用,如何制备性能优异的超厚 DLC 涂层成为亟待解决的科学性难题。另为,DLC 涂层在高温条件下,由于涂层的石墨化,涂层的摩擦学性能将会变差,在实际应用中,如何改善其高温摩擦性能(温度至少达 400 ℃),是 DLC 涂层得以广泛应用的另一重要指标。本文利用等离子体化学气相沉积法,制备了掺硅的超厚多层 DLC 涂层并研究了其在不同环境条件下(包括高温)的摩擦学性能。结果表明,超厚 DLC 涂层表面光滑,无明显缺陷,与基底之间的附着力和承载能力分别高达 40N 和 3.5GPa。在实验室环境,大气,水以及油润滑条件下,对钢对偶摩擦系数分别为 0.22,0.02 和 0.03,磨损率也都在 10⁻⁷ mm³/Nm 量级。在大气条件,温度在 100-300 ℃时,涂层的平均摩擦系数为 0.05。300 ℃时,涂层的摩擦系数随着测试时间变得不稳定,而当温度为 500 ℃时,其平均摩擦为 0.05。磨损率随着温度从 100 ℃增加到 500 ℃,其值从 2×10⁶ mm³/Nm 增加到 38×10⁶ mm³/Nm。

关键词:超厚类金刚石涂层,等离子体化学气相沉积法,摩擦学性能

1 实验部分

采用等离子体增强化学气相沉积在 304 不锈钢基底与 P(1 0 0) 硅片表面沉积了 Si-DL 单层或多层超厚 DLC 涂层。图一显示了超厚 DLC 涂层的结构示意图以及 SEM 图。在沉积之前, Si 基底在丙酮中超声波清 洗 10min, 然后在去离子水中冲洗后, 用流动的氮气吹干.薄膜沉积前, 真空室预抽至本底真空度 4×10⁻³Pa, 通入 Ar 气至 1 Pa, 偏压为 -5 KV,利用产生的辉光清洗衬底 10 min; 然后通入工作气体(纯度为 99.99% 的 Ar)与反应气体(纯度为 99.99% 的 C₂H₂)沉积 DLC 涂层,沉积过程中压强保持在 1-8 Pa. 沉积系统 包括真空室,真空泵,及两平行的不锈钢平板。薄膜沉积在整个沉积过程中,基底不加热,溅射功率设置 为 1.1 kW。本试验中为了测试摩擦学和机械性能而所选用的基底为 304 不锈钢基底,而为了测试涂层的结构特性所用的基底为 P(1 0 0) Si 基底。不同 Si 含量的 DLC 沉积参数如表一所示。最后通入不同量的 SiH₄ 和 C₂H₂作为前驱体气源,沉积单层不同 Si 含量 DLC 或多层 Si-DLC。

表面形貌与断面形貌分别利用原子力显微镜(AFM, CSPM4000, Benyuan, China)和扫描电子显微镜 (SEM, JSM-5310, JEOL)来观察。涂层与基底之间的界面微观结构利用高分辨透射电镜来观察(HRTEM, JE M -4000EX, JEOL)。采用 PHI-5702 多功能 X-ray 光电子能谱(美国物理电子公司)分析了薄膜表面组分, 选用 Mg-Kα 线作为激发源,通过能量为 29.4 eV,结合能测量精度±0.3 eV,腔内真空度约为 4×10⁶ Pa,以 污染碳 C1s 的结合能 284.8 eV 作为校准能级。利用 2000 micro-Raman 系统来得到涂层的 Raman 谱,波长 为 514.5 nm 扫描速率为 1800 line/nm。采用英国 Micro Materials Ltd 制造的 Nanotest 550 型纳米压痕仪测定

薄膜的硬度,为了减少基体对薄膜硬度测量的影响,选择压入深度为100nm,每个样品取5个点进行测量, 取平均值.采用 CSM 摩擦试验测试系统考察薄膜的摩擦磨损性能,对偶件为Φ3mm 的 GCr15 钢球(表面 粗糙度 Ra小于0.05μm,硬度 HV 580).摩擦磨损试验条件为:法向载荷 5-180N、滑动频率为5Hz、单次 滑动行程 5 mm.采用 Micro Xam 型三维表面形貌仪测量磨痕轮廓评价薄膜的抗摩擦磨损性能;同时采用 JSM-56oo LV 型扫描电子显微镜(SEM)观察试样磨损表面形貌.

2 结果与讨论



图一、多层超厚(Six-DLC/Siv-DLC)n/DLC的示意图和 SEM 图

Fig 1 (a) Schematic view of the (Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC film on the substrate and (b) SEM cross section of the (Six-DLC/Siy-DLC)n/DLCfilm with a thickness of 52.8 μ m

图一显示了多层超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC的结构示意图和 SEM 图,Si_x-DLC 和 Si_y-DLC 分别是 Si 含量为 7.14 和 14.79 at.%的掺 Si DLC 涂层。所制备的涂层断面光滑,无明显的缺陷。图二显示了多层超厚 (Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 内应力随厚度的变化趋势。从图中可以看出,随着多层结构的出现,涂层的内



图二、多层超厚(Six-DLC/Siy-DLC)n/DLC 内应力随厚度的变化

Fig.2. Residual stress of single and (Six-DLC/Siy-DLC)_n/DLC films as a function of the thickness.

应力显著的减小,即使当涂层的厚度增加到 50µm 时,涂层的内应力仅为 -0.08 GPa。造成这种结果的原因 可能有两点:第一,中间过渡层的出现造成了涂层结构从基底开始逐渐的变化,提高了涂层的附着力,减 小了内应力。第二,在沉积过程中张拉应力使得涂层发生方向相反的应变,但是 Si_x-DLC 和 Si_y-DLC 之间 的逐渐过渡结构又使得它们之间有很强的附着力,从而涂层整体内应力在这种结构中得到了释放,表现出 超低的内应力。

图三显示了超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 涂层在不同润滑条件下的摩擦系数。从图三可以看出,在大 气条件下,涂层的平均摩擦系数为0.22,在油环境中平均摩擦系数为0.02,而在水环境中摩擦系数仅为0.03。 上述结果表明,所制备的超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 在不同环境中都表现出优异的摩擦学性能。另外, 三种环境中的磨损率也都在10⁻⁷ mm³/Nm 量级。图四显示了超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 涂层承载能力随 厚度的变化。从图中可以看出,随着厚度的增加涂层的承载能力在逐渐的增加,在厚度为1.6 μm 时,涂层 的承载能力仅为1.5 GPa,而当涂层的厚度增加到52 μm 时,涂层表现出超高的承载能力,可高达3.2 GPa。



图三、超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 在空气,油润滑 及水润滑下摩擦系数随时间的变化。





图四、涂层承载能力随厚度的变化。其中承载能力 以涂层不发生失效所能承受的最大载荷为标准。 Fig. 4 Load- bearing capability as a function of the coating' thicknesses: (a) 2.6 µm; (b) 9.4µm; (c) 34.8 µ m; (d) 52.2 µm.

我们利用有限元方法模拟了(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 涂层在不同载荷下的应力分析,结果表明,当涂 层厚度较小时,最大应力集中的位置在涂层和基底的界面处,随着厚度的增加,最大应力集中的位置逐渐 向膜中转移,而界面处失效是涂层发生失效的主要形式,所以超厚涂层增加了涂层的承载能力。图五和图 六分别显示了超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 涂层在不同温度下的摩擦系数以及磨损率。从图中可以看出, 在温度低于 300 ℃时,涂层的平均摩擦系数为 0.05,在 300 ℃时,涂层的摩擦系数随着测试时间变得不稳 定,而当温度为 500 ℃时,其平均摩擦为 0.05。磨损率随着温度从 100 ℃增加到 500 ℃,其值从 2×10⁻⁶ mm³/Nm 增加到 38×10⁻⁶ mm³/Nm。



图五、超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n在不同温度下的摩擦 系数

Fig. 5 Friction coefficient as a function of the tested

temperatures



Fig. 6 Wear rate as a function of the tested temperatures

3 结论:

本文利用等离子体增强化学气相沉积法制备了单层不同 Si 含量 Si-DLC 涂层和多层超厚 (Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 涂层。研究了其结构,力学及摩擦学性能,主要结论如下:

(1) Si 在 Si-DLC 涂层中的含量可以通过调节沉积参数在 0-15at.%范围内变化。随着 Si 含量的增加,涂 层的内应力在张应力和拉应力之间可调。

(2)利用张拉应力特性可制备超低内应力 52μm 的超厚(Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC。超厚 (Si_x-DLC/Si_y-DLC)_n/DLC 在大气,水环境,油润滑以及高温条件下表现出优异的摩擦磨损性能,并表现出 超高的承载能力。 致谢: 感谢科技部 863 计划项目基金 (2009AA03Z105)、973 项目基金 (2011CB 706603) 和国家自然科学基金 (50905178&50772115) 的经费资助!

参考文献

[1] Casiraghi C, Ferrari AC, Robertson J. Raman spectroscopy of hydrogenated amorphous carbons. Physical Review B 2005;72:085401.

[2] Donnet C. Recent progress on the tribology of doped diamond-like and carbon alloy coatings: a review. Surface and Coatings Technology 1998;100–101:180-6.

[3] Roy RK, Lee K-R. Biomedical applications of diamond-like carbon coatings: A review. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 2007;83B:72-84.

[4] Sedlaček M, Podgornik B, Vižintin J. Tribological properties of DLC coatings and comparison with test results: Development of a database. Materials Characterization 2008;59:151-61.

[5] Liu X, Yang J, Hao J, Zheng J, Gong Q, Liu W. A Near-Frictionless and Extremely Elastic Hydrogenated Amorphous Carbon Film with Self-Assembled Dual Nanostructure. Advanced Materials 2012;24:4614-7.

[6] Wilhelmsson O, Råsander M, Carlsson M, Lewin E, Sanyal B, Wiklund U, et al. Design of Nanocomposite Low-Friction Coatings. Advanced Functional Materials 2007;17:1611-6.

[7] Zhou S, Wang L, Lu Z, Ding Q, Wang SC, Wood RJ, et al. Tailoring microstructure and phase segregation for low friction carbon-based nanocomposite coatings. Journal of Materials Chemistry 2012.

[8] Iseki T, Mori H, Hasegawa H, Tachikawa H, Nakanishi K. Structural analysis of Si-containing diamond-like carbon. Diamond and Related Materials 2006;15:1004-10.

[9] Lee K-R, Kim M-G, Cho S-J, Yong Eun K, Seong T-Y. Structural dependence of mechanical properties of Si incorporated diamond-like carbon films deposited by RF plasma-assisted chemical vapour deposition. Thin Solid Films 1997;308–309:263-7.

[10] Lee WY. X - ray photoelectron spectroscopy and Auger electron spectroscopy studies of glow discharge Si 1-x C x: H films. Journal of Applied Physics 1980;51:3365-72.

[11] Leung TY, Man WF, Lim PK, Chan WC, Gaspari F, Zukotynski S. Determination of the sp3/sp2 ratio of a-C:H by XPS and XAES. Journal of Non-Crystalline Solids 1999;254:156-60.

2 n